

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-118445

(43) 公開日 平成6年(1994)4月28日

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 F 1/136	5 0 0	9018-2K		
1/13	1 0 1	9315-2K		
H 0 1 L 27/12	A			
29/784				
	9056-4M		H 0 1 L 29/78	3 1 1 A
			審査請求 未請求 請求項の数3 (全 10 頁)	

(21) 出願番号 特願平4-271621

(22) 出願日 平成4年(1992)10月9日

(71) 出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72) 発明者 川井 悟

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72) 発明者 加藤 真也

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72) 発明者 井上 洋

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74) 代理人 弁理士 岡本 啓三

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 液晶駆動用 T F T のある液晶表示装置に関し、T F T の動作半導体層を薄くし、パターニング用マスクの作成工程の簡略化を図り、生産性を向上する。

【構成】 ゲート電極16の上に積層したゲート絶縁膜19と動作半導体層20とチャネル保護膜21Aをパターニングする際にポジ型イメージ・リバーサル・レジスト22を使用し、ゲート電極16を含むトランジスタ形成領域にあるそのレジスト22の上層に光を照射し、リバーサルベークして該部分を現像不能な変質部22Aとした後、透明基板11の上と下から光を照射し、変質部22Aとゲート電極16との間を除くイメージ・リバーサル・レジスト22を光照射状態にする工程と、現像により前記イメージ・リバーサル・レジスト22を断面T字型のパターンにする工程と、そのパターンをマスクに用いてチャネル保護膜21Aを等方性エッチングし、動作半導体層20とゲート絶縁膜19を異方性エッチングするパターニング工程を含む。

本発明の原理例

